

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第1区分
【発行日】令和6年12月17日(2024.12.17)

【国際公開番号】WO2023/190657
【出願番号】特願2024-512656(P2024-512656)
【国際特許分類】
G 0 1 N 2 7 / 3 0 (2 0 0 6 . 0 1)
C 2 3 C 1 4 / 0 6 (2 0 0 6 . 0 1)
【 F I 】
G 0 1 N 2 7 / 3 0 B
C 2 3 C 1 4 / 0 6 N

10

【手続補正書】
【提出日】令和6年8月28日(2024.8.28)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0052
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0052】

20

到達真空度は、例えば、 $0.00 \times 10^{-3} \text{ Pa}$ 超過、好ましくは、 $0.01 \times 10^{-3} \text{ Pa}$ 以上、より好ましくは、 $0.1 \times 10^{-3} \text{ Pa}$ 以上、さらに好ましくは、 $0.2 \times 10^{-3} \text{ Pa}$ 以上である。到達真空度が上記した下限以上であれば、スパッタリング室の減圧を開始してから、真空到達度時間（後述）を短くでき、そのため、製造効率を高めることができる。

【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0053
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0053】

30

1.4.2.9 真空到達時間

到達真空度に到達するまでの時間（真空到達時間）は、例えば、12時間以下、好ましくは、6時間以下、より好ましくは、3時間以下、さらに好ましくは、2時間以下である。真空到達時間が上記した上限以下であれば、製造効率を高めることができる。

40

50